庁 PATENT OFFICE JAPAN

REC'D 10 OCT 2003 PCT WIPO

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月26日

願 出 Application Number: 特願2002-245700

[ST. 10/C]:

[JP2002-245700]

人 出 願 Applicant(s):

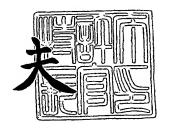
財団法人大阪産業振興機構

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

9月25日 2003年





【書類名】 特許願

【整理番号】 R6709

【提出日】 平成14年 8月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C07C239/14

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府吹田市山田西2-8 A9-310

【氏名】 佐々木 孝友

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府交野市私市8-16-19

【氏名】 森 勇介

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府池田市石橋1-21-18-232

【氏名】 吉村 政志

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府箕面市半町2-15-41-C205

【氏名】 安達 宏昭

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府東大阪市南鴻池町2-4-16

【氏名】 增原 宏

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市北区道場町日下部719-8

【氏名】 細川 陽一郎

【特許出願人】

【識別番号】 801000061

【氏名又は名称】 財団法人大阪産業振興機構

2/E

【代理人】

【識別番号】

110000040

【氏名又は名称】 特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ

【代表者】

池内 寛幸

【電話番号】

06-6135-6051

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

139757

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 結晶核の製造方法および結晶化条件スクリーニング方法 【特許請求の範囲】

【請求項1】 結晶化対象の溶質が溶解している溶液に対し、パルスレーザー を照射することにより結晶核を生成させる結晶核の製造方法。

【請求項2】 パルスレーザーをレンズで溶液中に集光し、その集光位置で単発若しくは複数発の局所的な爆発現象を生じさせ、これによって結晶核を生成する請求項1記載の製造方法。

【請求項3】 パルスレーザーの光密度が、 5×10^5 (watt) 以上である請求項1 または2 記載の製造方法。

【請求項4】 パルスレーザーのレーザー強度が、60 n J/pulse以上である請求項1から3のいずれかに記載の製造方法。

【請求項5】 パルスレーザーが、ナノ秒パルスレーザー、ピコ秒パルスレーザーおよびフェムト秒パルスレーザーの少なくとも一つである請求項1から4のいずれかに記載の製造方法。

【請求項6】 パルスレーザーの照射回数が、単発から1000万発である請求項1から5のいずれかに記載の製造方法。

【請求項7】 前記溶液が、過飽和溶液である請求項1から6のいずれかに記載の製造方法。

【請求項8】 請求項1から7のいずれかに記載の方法を実施するための結晶 核製造装置であって、パルスレーザー照射手段を有する装置。

【請求項9】 請求項1から7のいずれかに記載の方法により溶液中に結晶核を生成させ、これを基に結晶を成長させる結晶の製造方法。

【請求項10】 結晶化対象の溶質が、有機物である請求項9記載の製造方法

【請求項11】 結晶化対象の溶質が、タンパク質である請求項9記載の製造方法。

【請求項12】 結晶化対象の溶質が溶解している溶液に対し、パルスレーザーを照射する工程と、前記レーザー照射により結晶核が生成するか否かを判定す

る工程および前記レーザー照射により溶質が変化しているか否かを判定する工程 の少なくとも一方とを含む結晶化条件のスクリーニング方法。

【請求項13】 パルスレーザーをレンズで溶液中に集光し、その集光位置で 単発若しくは複数発の局所的な爆発現象を生じさせ、これによって結晶核を生成 若しくは溶質の変性を誘起する請求項12記載のスクリーニング方法。

【請求項14】 パルスレーザーの光密度が、 5×10^5 (watt) 以上である 請求項12または13記載のスクリーニング方法。

【請求項15】 パルスレーザーのレーザー強度が、60nJ/pulse以上である請求項12から14のいずれかに記載のスクリーニング方法。

【請求項16】 パルスレーザーが、ナノ秒パルスレーザー、ピコ秒パルスレーザーおよびフェムト秒パルスレーザーからなる群から選択される少なくとも一つである請求項12から15のいずれかに記載のスクリーニング方法。

【請求項17】 パルスレーザーの照射回数が、単発から1000万発である 請求項12から16のいずれかに記載のスクリーニング方法。

【請求項18】 前記溶液が、過飽和溶液である請求項12から17のいずれかに記載のスクリーニング方法。

【請求項19】 結晶化対象の溶質が、有機物である請求項12から18のいずれかに記載のスクリーニング方法。

【請求項20】 結晶化対象の溶質が、タンパク質である請求項12から18 のいずれかに記載のスクリーニング方法。

【請求項21】 請求項12から20のいずれかに記載のスクリーニング方法 を実施するためのスクリーニング装置であって、パルスレーザー照射手段を有す る装置。

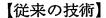
【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、結晶核の製造方法および結晶化条件のスクリーニング方法に関する

[0002]



ポストゲノム研究の進展により、タンパク質の構造解析が急務になってきているが、そのためには、タンパク質を結晶化する必要がある。また、有機結晶は、次世代デバイス材料として有望視されており、その高品質結晶製造技術のニーズが高い。一般に、溶液から結晶を析出させるためには、溶媒蒸発や温度変化などにより過飽和度を大きくする必要がある。しかし、有機物やタンパク質等のように分子量が大きい物質は、過飽和度を極めて大きくしないと結晶化しない。また、このような極めて大きな過飽和度の溶液では、一度結晶化が起こると、結晶が急成長するため、得られる結晶の品質に問題があるおそれがある。また、このような高分子量物質の結晶化は、一般に困難であり、生産性が悪かった。通常、結晶化の条件は、実際に結晶化を試みて、試行錯誤の結果、決定されるが、これでは、タンパク質や有機物等のように、結晶化が必要不可欠な物質では、煩雑すぎて、実用的ではない。

[0003]

【発明の解決しようとする課題】

本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、高品質の結晶を簡単に効率 よく製造できる技術を提供することを第1の目的とし、結晶化条件を簡単に決定 できる技術を提供することを第2の目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】

前記第1の目的を達成するために、本発明の結晶核の製造方法は、結晶化対象 の溶質が溶解している溶液に対し、パルスレーザーを照射することにより結晶核 を生成させる方法である。

[0005]

このように、パルスレーザーを照射すれば、低過飽和溶液であっても結晶核が 生成するので、これを基に、結晶をゆっくり成長させることができ、その結果、 高品質の結晶が簡単に効率良く製造できる。本発明の方法は、タンパク質の結晶 化および有機物の結晶化に最適であるが、その他の物質の結晶化にも使用できる

[0006]

また、前記第2の目的を達成するために、本発明の結晶化条件のスクリーニング方法は、結晶化対象の溶質が溶解している溶液に対し、パルスレーザーを照射する工程と、前記レーザー照射により結晶核が生成するか否かを判定する工程および前記レーザー照射により溶質が変化しているか否かを判定する工程の少なくとも一方とを含む方法である。

[0007]

このように、パルスレーザーを照射して結晶核の生成を観察し、結晶核が生成すれば、その溶液等の条件は、結晶化に適していると判断できる。また、パルスレーザーを照射して溶質の状態を観察し、溶質が変化していれば、その溶液等の条件は結晶化に適していると判断できる。前記溶質の変化は、タンパク質の場合、例えば、立体構造の変化(変性)である。

[0008]

過飽和溶液にパルスレーザーを照射すれば、結晶核が生成するが、そのメカニズムは不明である。これについて、本発明者等は、以下のように推測している。すなわち、パルスレーザーの焦点では、高密度の光子が集中するために、一つの溶質分子もしくは溶媒分子に光子が数個衝突し、それらが光を吸収する現象(多光子吸収)が高い確率で起こる。その結果として、パルスレーザーを集光した時、その焦点で急激な光吸収による爆発現象(レーザーアブレーション)が誘起される。結晶核生成は、これが摂動となり起こると考えられる。そして、その後のメカニズムにとしては、下記の3つの考えられる。

[0009]

- (1) パルスレーザーにより光熱変換が引き起こされ焦点付近の溶液が瞬間的に蒸発し、溶質の濃縮が起こった結果として結晶核が生成する。
- (2) パルスレーザーが誘起するアブレーションにより衝撃波が発生し、それにより溶液が局所的に揺らされた結果として結晶核が生成する。
- (3) レーザーの強度が強くなると溶液中で誘導散乱が引き起こされ、溶液中に濃度勾配が生成し、結晶核が生成する。

[0010]

【発明の実施の形態】

つぎに、本発明をさらに詳しく説明する。

[0011]

前述のように、本発明では、パルスレーザーをレンズで溶液中に集光し、その 集光位置で単発若しくは複数発の局所的な爆発現象を生じさせ、これによって結 晶核を生成することが好ましく、また前記爆発現象により、溶質を変化させるこ とも好ましい。

[0012]

本発明において、パルスレーザーの光密度(光子流量:photon flux)は、例えば、 5×10^5 (watt)以上であり、好ましくは 2×10^9 (watt)以上である。パルスレーザーの光密度の上限は、特に制限されないが、例えば、 10^{18} (watt)以下であり、好ましくは 10^{15} (watt)以下であり、より好ましくは 10^{12} (watt)以下である。

[0013]

後述するように、レーザー光強度(W)および時間幅(△t)の積が、光密度(I)であるから、レーザーの条件は、時間幅によって、例えば、以下のように設定することができる。なお、パルスレーザーは、例えば、ナノ秒パルスレーザー、ピコ秒パルスレーザーおよびフェムト秒パルスレーザーがあり、このなかで、フェムト秒レーザーが特に好ましい。

[0014]

(ナノ秒パルスレーザー)

	パルス時間幅	レーザー光強度A	レーザー光強度B
	(秒)	(J/pulse)	(J/pulse)
一般的範囲	10-6~10-9	$0.5 \sim 0.5 \times 10^{-3}$	$2 \times 10^{3} \sim 2$
好ましい範囲	10-8~10-9	$0.5 \times 10^{-2} \sim 0.5 \times 10^{-3}$	$3 \times 10 \sim 2$

レーザー光強度A:光密度 (I) = 5×10^5 (watt) 以上の場合

レーザー光強度B:光密度 $(I) = 2 \times 10^9$ (watt) 以上の場合

[0015]

(ピコ秒パルスレーザー)

	パルス時間幅	レーザー光強度A	レーザー光強度B		
	(秒)	(J/pulse)	(J/pulse)		
一般的範囲	$10^{-9} \sim 10^{-12}$	$0.5 \times 10^{-3} \sim 0.5 \times 10^{-6}$	$2\sim 2\times 10^{-3}$		
好ましい範囲	$10^{-11} \sim 10^{-12}$	$0.5 \times 10^{-5} \sim 0.5 \times 10^{-6}$	$2 \times 10^{-2} \sim 2 \times 10^{-3}$		
レーザー光強度A:光密度(I)= 5×10^5 ($watt$)以上の場合					

レーザー光強度B:光密度 $(I) = 2 \times 10^9$ (watt) 以上の場合

レーザー光強度B:光密度 (I) = 2×10^9 (watt)以上の場合

[0016]

(フェムト秒パルスレーザー)

	パルス時間幅	レーザー光強度A	レーザー光強度B		
	(秒)	(J/pulse)	(J/pulse)		
一般的範囲	$10^{-12} \sim 10^{-15}$	$0.5 \times 10^{-6} \sim 0.5 \times 10^{-9}$	$9 2 \times 10^{-3} \sim 2 \times 10^{-6}$		
好ましい範囲	$10^{-13} \sim 10^{-15}$	$0.5 \times 10^{-7} \sim 0.5 \times 10^{-1}$	$9 2 \times 10^{-4} \sim 2 \times 10^{-6}$		
レーザー光強度A:光密度(I)= $5 imes10^5$ (w att)以上の場合					

[0017]

パルスレーザーは、単発で照射してもよいし、複数発繰り返して照射してもよ い。パルスレーザーの照射回数は、特に制限されないが、例えば、1発(単発) から1000万発の範囲である。また、繰り返し複数発照射する場合のレーザー 繰り返し周波数は、例えば、1/1000000Hz~1kHzの範囲である 。照射時間も特に制限されず、例えば、1秒から1時間の範囲である。

[0018]

パルスレーザーの具体例としては、例えば、フェムト秒チタンサファイアレー ザー、フェムト秒ファイバーレーザー、ナノ秒・ピコ秒Nd3+:YAGレーザー 、ナノ秒・ピコ秒 Nd^{3+} : VYO_4 レーザー、エキシマレーザーおよびアレクサ ンドライトレーザー等がある。

[0019]

本発明において、結晶化対象の溶質が溶解している溶液は、過飽和溶液である ことが好ましく、より好ましくは低過飽和溶液である。タンパク質溶液の濃度は 、例えば、 $200\sim500\%$ であり、好ましくは $100\sim300\%$ であり、より好ましくは $50\sim200\%$ である。有機物溶液の濃度は、例えば、 $20\sim50\%$ であり、好ましくは $10\sim30\%$ であり、より好ましくは $5\sim20\%$ である。また、本発明の対象となるンパク質としては、例えば、リゾチーム、グルコースイソメラーゼ、キシラーゼ、ミオグロビン、カタラーゼ、トリプシン、ヒトリゾチーム、フォトアクティブイエロープロテイン等がある。有機物としては、例えば、4-dimetylamino-N-metyl-4'-N-stilbazolium tosylate (DAST) 等がある。

[0020]

つぎに、本発明の方法を実施するための装置の一例を図1に示す。図示のよう に、この装置は、フェトム秒レーザー照射手段1、機械シャッター2、半波長板 3、偏光子4、集光レンズ5、恒温水槽8を有する。恒温水槽8の中には、水9 が入っており、その中に、結晶化対象の溶質が溶解した溶液7が入った試料容器 6が配置される。恒温水槽8では、温度を徐々に低下させることで、溶液7の溶 解度を低下させて過飽和状態にする。この時、過度の過飽和にすると結晶成長が 速くなるので、低度の過飽和にする。そして、レーザー照射手段1よりレーザー 光10を照射すると、レーザー光10は、機械シャッター2、半波長板3、偏光 子4および集光レンズ5を通過し、溶液7内で集光し、ここで急激な光吸収によ る爆発現象がおき、これが結晶核生成を誘引する。結晶を成長させる場合は、こ の結晶核を基に、時間をかけてゆっくりと成長させれば、高品質の単結晶が得ら れる。また、結晶化条件をスクリーニングする場合、溶液の濃度、溶質の構成比 率、温度条件を少しずつ変えた溶液を複数準備し、それらにレーザー光を照射後 、溶液を観察する。そして、結晶核の生成や溶質の変化が確認できた場合、その 溶液は結晶化条件に適していると判断し、そうでない場合は、結晶化条件不適と 判断する。本発明のスクリーニング方法は、結晶化条件決定の一次スクリーニン グとして使用することが好ましい。

[0021]

【実施例】

つぎに、本発明の実施例について比較例と併せて説明する。

[0022]

(装置)

図1に示す装置を実施例に用いた。この装置は、高出力フェムト秒チタンサファイアレーザー10を焦点距離170 mmのレンズ 5 により集光し、恒温水槽 8 中の試料溶液 7 に照射する装置である。恒温水槽 8 は、温度を±0.05℃の精度で制御できる。レーザー10の波長は800mm、時間幅は120fsである。レーザー発振の繰り返し周波数は1 kHzから1 Hzまで調整できる。試料溶液 7 に単発のレーザーパルスを照射するときは、繰り返し周波数を20 Hzに調節し、そのパルス列から機械シャッター2を50 msだけ開くことにより単発パルスを抜き出す。レーザー光強度は、半波長3と偏光子4 により調整できる。この装置では、試料溶液 7 に対して強度250 μ J/pulse (2×10 9 watt)のレーザーパルスを照射することができる。

[0023]

(実施例1)

DAST (4-dimetylamino-N-metyl-4'-N-stilbazolium tosylate) 3.5gを、メタノール200mlおよび回転子と共に、容量200mlのテフロン(登録商標)容器 6 に入れ、初期温度27.0℃の恒温水槽 8 内にて2時間で55.0℃まで上昇させ、スターラ撹拌しながら溶解させた。約5時間後にDASTが溶解しているのを確認して溶液 7 を3つに分け、育成溶液とした。この際、回転子は取り除いた。溶液準備16時間後に、55℃で10時間加熱後、毎時間3℃づつ下げて23℃まで温度を降下させた。さらに、毎時間0.1℃で下げ21.4℃まで温度を降下させた。この状態で、フェムト秒レーザーを光強度 $250\,\mu$ J/pulse(2×10^9 watt)、繰り返し周波数1kHzで 2分間照射した。その後、1時間は結晶析出のないことを確認し、その10時間後に肉眼で結晶が析出していることを確認した。前記温度を保持したまま、約6日観察を続けたところ、最初に発見した結晶は成長し、更に2、3個の結晶を確認した。再び強度 $250\,\mu$ J/pulse(2×10^9 watt)、繰り返し周波数1kHzで1分間レーザーを照射し、その後3日間は結晶析出のないことを確認した。

[0024]

(実施例2)

結晶核生成対象として、鶏卵白リゾチームを使用した。その溶液は、蒸留水50

mlに酢酸ナトリウム三水和物0.467gを加え、これに酢酸を加えてpH4.5に調整し た後、塩化ナトリウム1.25gおよび鶏卵白リゾチーム1.25gを加えて調製した。室 温に調整した前記試料溶液7を、100mlのテフロン (登録商標)容器6に入れ、恒 温水槽8にて40℃で24時間保持し、完全に溶解させた。その後、25℃まで5時間 で冷却し、メンブランフィルタにて不純物を除去した。その溶液2mlとフロリナ ート3mlを、10本の直径18mmのネジ蓋付きガラス瓶6にそれぞれ注入した。こ れらのガラス瓶6を25℃に保持した恒温水槽8内に静置させ、溶液温度を15℃ま で20時間で降下させた。この試料溶液(リゾチーム溶液)7の飽和点は23.8℃で ある。そして、結晶の析出がないことを確認して14℃まで24時間で降下させ、14 ℃で24時間保持し、再度、結晶の析出がないことを確認した。そして、光強度25 $0 \mu J/\text{pulse} (2 \times 10^9 \text{watt})$ のフェムト秒パルスレーザーを溶液7内に1 分間、順次照射して、変化を観察した。照射条件は、レーザーの繰り返し周波数 を変化させ、50Hz、100Hzで、それぞれ前記ガラス瓶2本ずつ照射し、コントロー ルとして4本の前記ガラス瓶にはレーザーを照射しなかった。レーザー照射1日後 に、50Hz、100Hzの溶液中に結晶が析出していることを肉眼で確認した。レーザ ーを照射していない溶液では結晶の析出は見られなかった。また、結晶の析出が 見られなかった溶液に500Hz、1000Hzのレーザーをそれぞれ照射したところ、溶 液内に、リゾチームが凝集(変性)しているのが観察され、この溶液は結晶化の 可能性ありと判定した。

[0025]

(比較例)

実施例 2 と同じ条件のタンパク質溶液を用いて、YAGVーザー(波長1064nm、5 n s)を照射して結晶核の生成を試みた。前記タンパク質溶液は、蒸留水50 mlに酢酸ナトリウム三水和物0.467gを加え、これに酢酸を加えてpH4.5に調整した後、塩化ナトリウム1.25gおよび鶏卵白リゾチーム1.25gを加えて調製した。室温に調整した前記試料溶液 7 を、100mlのテフロン(登録商標)容器に入れ、恒温水槽にて40Cで24時間保持し、完全に溶解させた。その後、25Cまで5時間で冷却し、メンブランフィルタにて不純物を除去した。その溶液2mlとフロリナート3mlを、1 0本の直径18mmのネジ蓋付きガラス瓶にそれぞれ注入した。これらのガ

ラス瓶を25℃に保持した恒温水槽内に静置させ、溶液温度を15℃まで20時間で降下させた。この試料溶液(リゾチーム溶液)の飽和点は23.8℃である。そして、結晶の析出がないことを確認して14℃まで24時間で降下させ、14℃で24時間保持し、再度、結晶の析出がないことを確認した。そして、YAGレーザーを溶液内に1分間、順次照射して、変化を観察した。照射条件は、レーザーの繰り返し周波数を変化させ、10Hz、20Hz、50Hz、100Hz、500Hz、1000Hzをそれぞれ照射し、コントロールとして4本のガラス瓶にはレーザーを照射しなかった。レーザー強度は1.2m J/pulseであった。レーザー照射1日後、結晶の析出は確認できず、さらに過飽和度を大きくするため16℃まで10時間で降下させ、12時間保持し、結晶の析出がないことを確認して、再度レーザーを照射した。照射条件は上記と同じである。この時も結晶の析出は確認できず、同様に、15℃、14℃でもレーザー照射したが、結局、結晶の析出は確認できず、同様に、15℃、14℃でもレーザー照射したが、結局、結晶の析出および変性を確認できなかった。この例での光強度は、実施例で用いたフェムト秒パルスレーザーよりも10倍大きいが、光密度(光子流量)は2.5×105(watt)であり、実施例の一万分の一であり、これが原因で結晶核が生成しなかったと推察できる。

[0026]

(参考例)

図2に示す装置を用いてパルスレーザーの爆発現象により生じであろう衝撃波を調べた。この装置は、パルスレーザー照射装置を正立顕微鏡に組み込んだものである。図示のように、正立顕微鏡11は、観察対象物を置くステージ28と、コンデンサーレンズ29と対物レンズ(100倍、開口数1.25)26を備え、前記ステージ28の上には、マイクロチップ27が配置されている。また、正立顕微鏡11下部のコンデンサーレンズ29下には、光源ランプ13が配置され、この光を検出するCCDカメラ12が顕微鏡11上部に配置されている。また、正立顕微鏡11外部にパルスレーザー照射装置21が配置されており、レーザー22は、1/2波長板23および偏光子24を通って正立顕微鏡11内に照射され、ダイクロイックミラー25によって光路が直角に曲げられてステージ28上のマイクロチップ7内に照射されるようになっている。前記パルスレーザーとしては、チャーブ増幅による高出力フェムト秒チタンサファイアレーザー(800 n

m, 120 fs)を使用している。また、マイクロチップ 2 7内には、ポリスチレン微粒子(直径 $1~\mu$ m)の分散液が入っている。この装置において、レーザー 2 2 を照射すると、ステージ 2 8上に配置されたマイクロチップ 2 7内のポリスチレン微粒子分散液にレーザー 2 2 が集光する。そして、マイクロチップ 2 7内の様子は、CCDカメラ 1 2 で観察する。

[0027]

つぎに、この装置を使い、ポリスチレン微粒子に対する衝撃波の影響を調べた 。すなわち、前述の条件により、ポリスチレン微粒子分散液内に単発でフェムト 秒チタンサファイアレーザーを照射した。レーザーの集光点で発生すると予想さ れる衝撃波は3次元的に拡散し、微粒子はレーザー集光点から遠ざかる方向へ押 される。この衝撃波によるポリスチレン微粒子の動きをCCDカメラで観察し、 レーザーの集光点から離れる距離を調べることにより、衝撃波の大きさを見積も った。図3は、パルスレーザー照射による衝撃波がポリスチレン微粒子に与える 力の関係を模式的に表したものである。同図において、f は微粒子が受ける衝撃 波の力を示し、 F_0 は衝撃波により発生する力を示し、 R_0 は微粒子の初期位置を 示し、Rは衝撃波中心からの微粒子の位置を示し、rは微粒子の半径を示し、3 2はレーザー光を示し、33はポリスチレン微粒子を示し、34はレーザーの集 光点を示し、37はポリスチレン微粒子分散液を示す。また、図4は、パルスレ ーザー照射と、その衝撃波による微粒子の移動距離の関係を示すグラフである。 同図において、横軸は、時間を示し、縦軸は、衝撃波中心からの微粒子の位置(R) を示し、R₀は微粒子の初期位置を示し、Lは微粒子の移動距離を示し、黒 丸はパルスレーザーの照射時間を示す。このグラフに示すように、パルスレーザ ーが照射されると、微粒子が瞬間的に焦点から遠ざかることが解る。衝撃波がイ ンパルス応答で3次元的に等方的に伝搬して、微粒子が水の粘性抵抗により停止 すると仮定した場合、以下の式が成立し、微粒子の初期位置(R₀)と移動距離(L) の関係から衝撃波により発生する力(F₀)を見積もることができる。

[0028]

【式1】

微粒子の受ける衝撃波の力:

$$f = F_0 \frac{\pi r^2}{4\pi R_0^2} \delta(t)$$

微粒子の運動方程式:

$$m\frac{d^2R}{dt^2} = -6\pi\eta r\frac{dR}{dt} + f$$

微粒子の変位量:

$$L = R(t = \infty) - R_0$$

$$\Leftrightarrow L = \frac{F_0 \cdot r}{24\pi\eta} \cdot \frac{1}{R_0^2}$$

[0029]

このようにして、数百にのぼる微粒子の動きを観測し、フェムト秒チタンサファイアレーザーの光強度と衝撃波により発生する力の関係を求めた。その結果を、図6のグラフに示す。このグラフにおいて、縦軸は衝撃波の力(F_0)を示し、横軸はレーザー光強度(I_0)を示す。図示のように、この参考例では、60n J/pulse以上で衝撃波を確認できた。爆発現象の閾値は、多光子吸収の確率に依存するため、レーザーエネルギーの総量として定義されるレーザー強度ではなく、瞬間的に到達する光の密度(I)により関係づけられる。この参考例では、時間幅(Δ t)120fsのパルスレーザーのレーザー強度(W)が60nJ/pulseであったから、その光密度(I)は、以下のようになる。

[0030]

 $I = W / \triangle t = 5 \times 10^5 \text{ (J/s·pulse=watt)}$

[0031]

したがって、この参考例では、時間幅(\triangle t)は、 \triangle t <W $/5 \times 10^5$ となる。この式とレーザー照射装置の能力とを考慮すると、ナノ秒以下の時間幅を持つパルスレーザーが好ましく、より好ましくはピコ秒以下、最適にはフェムト秒以下である。なお、この参考例によって、本発明は限定的に解釈されない。また、この参考例では、レーザー集光点で爆発現象が起きて衝撃波が発生すると仮定しているが、本発明は、これに限定されない。

[0032]

【発明の効果】

以上のように、本発明によれば、結晶化が困難なタンパク質や有機物であって、容易に効率良く結晶核を生成でき、これをゆっくり成長させれば高品質の結晶が得られる。また、本発明によれば、結晶化条件をスクリーニングでき、結晶化条件を迅速に決定できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施例に使用したレーザー照射装置の構成図である。

【図2】

図2は、レーザー照射による衝撃波の大きさを測定する装置の一例を示す構成 図である。

【図3】

図3は、パルスレーザーの衝撃波と粒子の動きとの関係の一例を示す模式図である。

【図4】

前記装置で測定した衝撃波による粒子の移動距離とレーザー集光点との関係を示すグラフである。

【図5】

図5は、前記装置で測定した衝撃波の強度とレーザー強度との関係を示すグラ



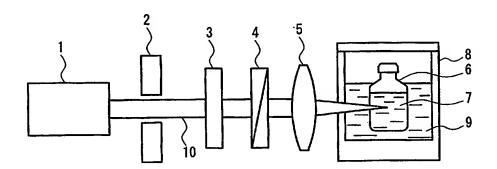
【符号の説明】

- 1 レーザー照射手段
- 2 機械シャッター
- 3 半波長板
- 4 偏光子
- 5 集光レンズ
- 6 試料容器
- 7 溶液
- 8 恒温水槽
- 9 水

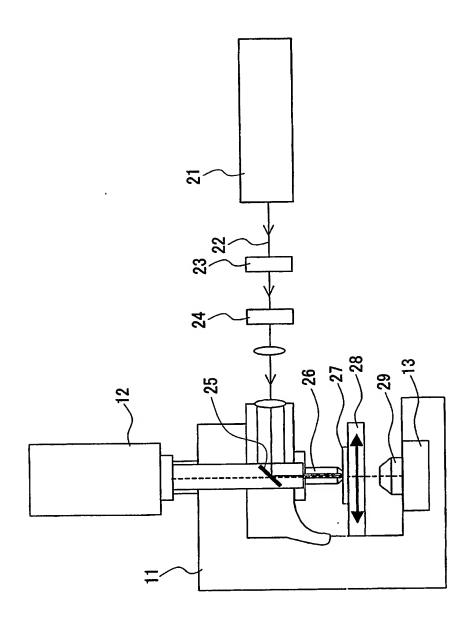


図面

【図1】

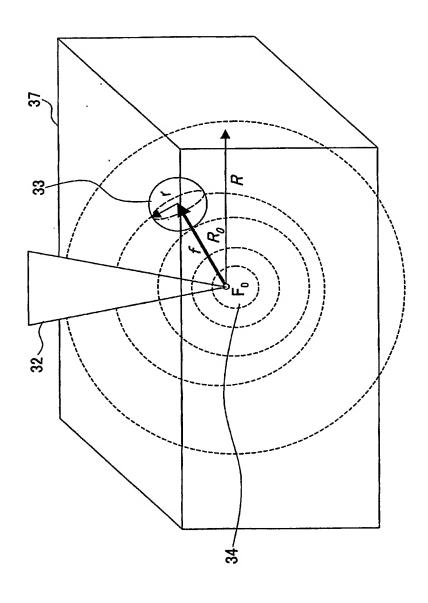






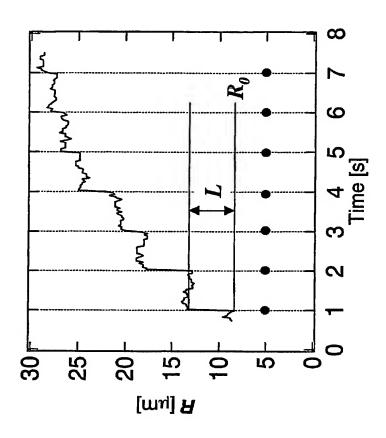


【図3】



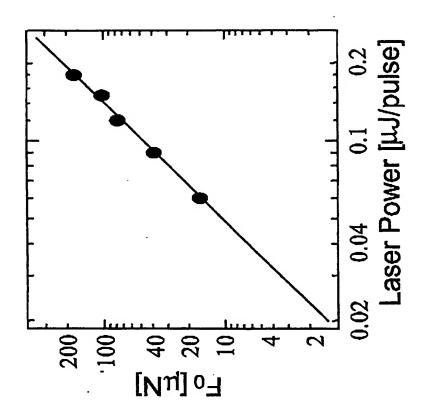


【図4】





【図5】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 タンパク質や有機物の結晶を、高品質で効率良く簡単に製造する。

【解決手段】 タンパク質や有機物の溶液を調製し、これをゆっくりと冷却することによって低度の過飽和にする。この過飽和溶液に、フェムト秒レーザー10を照射する。レーザーの焦点では、局所的な爆発現象が起きて結晶核が生成する。この結晶核を基に、時間をかけて結晶を成長させれば、高品質の結晶が得られる。フェムト秒レーザーとしては、波長800 nm、時間幅120 fs、周波数1kHz、出力400mWのチタンサファイアレーザーが使用できる。

【選択図】 図1



特願2002-245700

出願人履歴情報

識別番号

[801000061]

1. 変更年月日

2001年 9月13日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区本町橋2番5号 マイドームおおさか内

氏 名 財団法人大阪産業振興機構

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.